

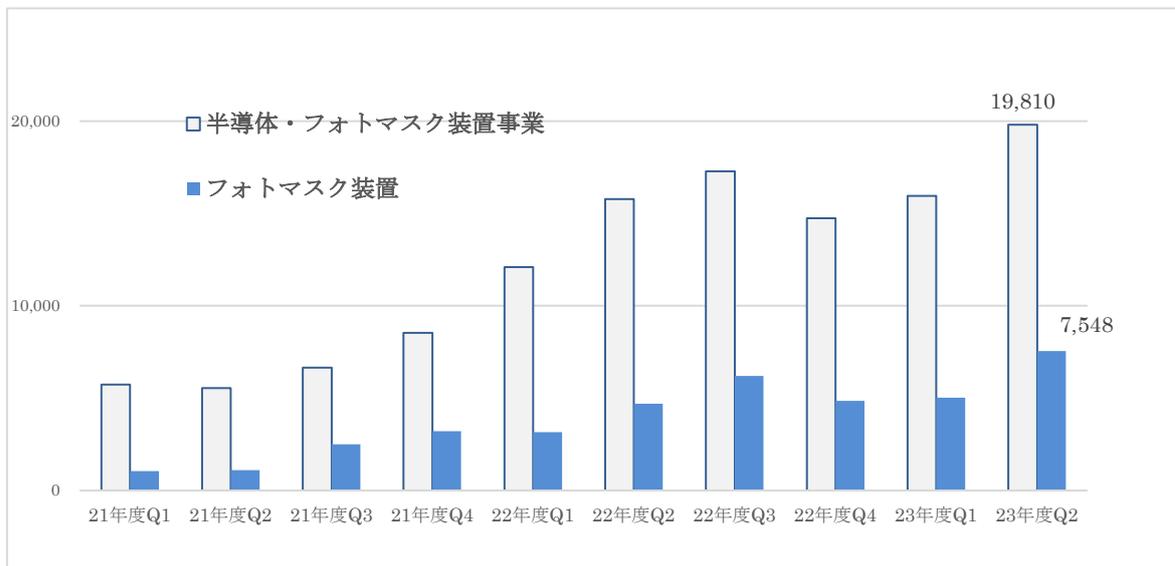
2023年11月20日

PR情報

会社名 株式会社 ブイ・テクノロジー
 代表者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人
 (コード番号：7717 プライム市場)
 問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
 (TEL：045-338-1980)

フォトマスク製造装置の受注残高が過去最高額を更新

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134横浜ビジネスパークイーストタワー9F 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人、以下「当社」）は、フォトマスク製造装置の受注残高が、2024年3月期の中間決算にて過去最高額を更新し、約75億円となりましたので下記にお知らせいたします。



半導体・フォトマスク装置事業と、当該事業の主力であるフォトマスク用装置の受注残高の推移(百万円)

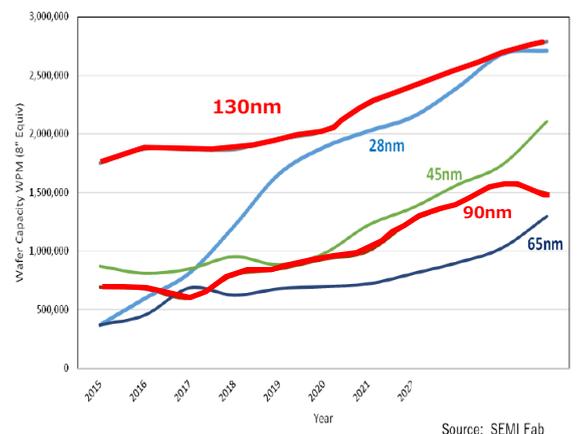
記

1. 背景

脱炭素社会の実現に向けたGX(グリーントランスフォーメーション)や、地域独自の半導体のサプライチェーンの立ち上げを目指す動き等が世界的に活発化する中で、パワー半導体に代表されるレガシー半導体の需要については、中長期の持続的な成長が見込まれています。

このような状況の下、各国ではレガシー半導体の生産能力を増強させる為に、大規模な設備投資(右図90~130nm)を本格化させており、製造に不可欠なフォトマスク製造に関連する投資も増加傾向にあります。

(図) デザインルール別の生産能力推移 (2023年以降は予測) SEMI データより当社作成



Source: SEMI Fab

2. 欠陥検査装置「Dione（ディオオーネ）」が受注残の増加を牽引

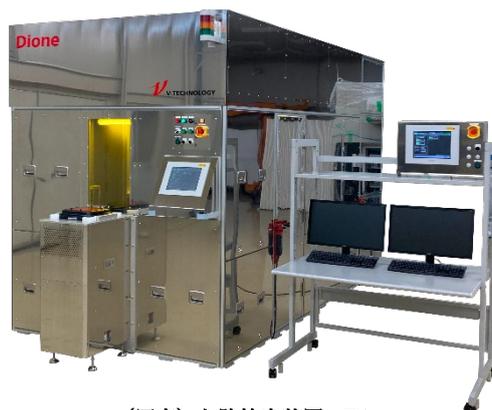
Dione は、FPD 用に開発された検査装置「Gemini」で培った技術をベースに、お客様のご要望を取り入れ半導体用に再設計された、高速・高精度な検査装置です。

高速 TDI を使って透過検査・反射検査を同時に行えるため、検査時間を 1/2～1/4 に短縮可能です。

加えて、省スペース設計により装置の設置スペースに制限がある事が多い既存のクリーンルームから新設の工場まで、場所を選ばず様々なシーンでお使いいただくことができ、国内外のお客様から数多くのご注文と引合いを頂戴しております。

特長

- 高速、高分解能で Die to Database、Die to Die 検査が可能
- 専用 Database エンジン（RIG System）を搭載、高密度データ対応
- 光源にランプを使用し、低ランニングコストを実現
- 透過検査/反射検査の同時検査可能
- 検査中レビュー機能/他



（写真）欠陥検査装置 Dione
半導体用フォトマスク上にあるパターン欠陥、異物検査を高速、高精度で行う欠陥検査装置

3. 今後について

今後は、短波長化により更に微細なデザインルールで設計された半導体の製造に対応する技術の開発を急ぐと共に、業務提携や M&A 等によるビジネスパートナーの獲得にも積極的に取り組み、地域を超えて世界中の半導体製造のお客様に貢献できますよう、尽力してまいります。

以上